

2019年8月2日

瑞翁上市了下一代电子束抗蚀剂。**瑞翁株式会社**

瑞翁株式会社这次上市了面向制造下一代电子零部件的正型电子束抗蚀剂的新型 ZEP530A 系列。

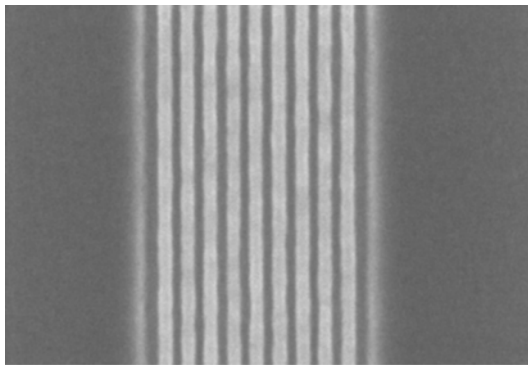
做为晶片上面转印半导体电路图形时使用的保护膜，瑞翁株式会社从很早以前就开展了主链裂解性正型电子束抗蚀剂 ZEP 系列，并已被国内外广泛客户采用。此次我司以现有型号 ZEP520A 技术为基础，开发并上市了可实现更高分辨率的 ZEP530A 系列。

ZEP530A 系列拥有优良的耐干腐蚀性，同时提高了分辨率和工艺宽容度。由于 ZEP530A 的进一步的薄膜化，已确认了 half-pitch(半间距)17 纳米的线宽图形的分辨率。

另外为了实现 ZEP530A 的高分辨率，同时开发并上市了新型显影液 ZED-N60。

做为 ZEP530A 的主要用途之一将用于制造下一代电子零部件，期待推广到即将开始产业化的 5G 移动通信系统的零部件。

瑞翁集团今后也将继续促进运用最新技术开发新产品，努力给客户id提供有价值的产品。



膜厚：40nm

电子束曝光：ELS-F150 (ELIONIX INC.)

*扫描电子显微镜俯视图

*L/S: Line and Space 图形